

E-mail_Communication_on_Sony_Loral_Patent_War

E-MAIL communication on Sony-Fairchild Patent War

February 6, 1996

Evidence of Hagiwara contribution in the Patent War

(1) 当時のSONY中央研究所所長の山田敏之さんからのメッセージ

Subject: CCD Patent Report

X-Mailer: Eurora-J(1.3.8.5-J13)

中研の山田です。

ずいぶん前になりますが、分厚いレポートを送って頂きありがとうございました。

CCD裁判は越智さんはじめ関係者の大きな努力にもかかわらず（一審での判決では）不本意な結果となりましたが（その後逆転勝利となり）アメリカの裁判制度の問題点を如実に表しているような気がします。

それはそれとして、この過程で萩原さんのこの資料が越智さんにとっても大いに参考になったようです。

ご協力ありがとうございました。

CCD開発史の一ページというか、読み物としても面白く読ませて頂きました。

裁判の方はまだこれから延々と（最高裁まで）続くでしょうが、引き続きご支援をお願いします。

萩原さんのことですから自分のやりたいことをやりたいようにやっておられることと推察します。

私も少しその爪の垢を煎じて飲みたいものです。すっかり遅くなりましたがひとこと御礼まで。

以上

E-mail_Communication_on_Sony_Loral_Patent_War

Date: Tue. 6 Feb 9608:51:07 JST

To: hagiwara@mica.semicon.sony.co.jp(NanaeSato)

From:nanae@avzna.av.crl.sony.co.jp

Subject:testimony3

Cc: msato@saccd.semicon.sony.co.jp,ochi@av.crl.sony.co.jp

X-Mailer: Eurora-J(1.3.8-J13)

おはようございます。

中央越智副所長からのe-mailをforwardします。

お忙しいのにもかかわらず、
多大なご協力をごさいますして
ありがとうございました。

2) SONYの森尾副社長、高橋専務、山田所長に対して
米国滞在の越智さんから発信された裁判に関する報告

>X-POP3-Rcpt: nanae@avzna

>Date: Tue. 6, Feb 96 06:48:53 JST

>To: m-morio@cv.sony.co.jp, takahasi@rd.sony.co.jp,
>hashi@re.sony.co.jp,tyamada@dpo.crl.sony.co.jp

>Cc: ochi@av.crl.sony.jp,
>msato@saccd.semioch.sony.co.jp,nanae@av.crl.sony.co.jp

>Subject: testimony3

>From: 越智 成之 <ochi@av.crl.sony.co.jp>

>X-Mailer: Winbiff[version 1.50 beta1]

>私に対する証人尋問が終わりました。

>direct exam は主に

>74年のAmelio (Apple Computerの社長になってしまいましたが)
>特許や桑沢、松本レポートより前に、
>既に two phase overlapping gate buried channel self aligned implanted barrier
>が考えられていたことを、

>Caltech (Bower, McGill, Daimon-Hagiwaraほか)
>と Hughes(Erb, Sulほか) と Sony (三船,二神ほか) 等の資料を使い、
>実証致しました。

E-mail_Communication_on_Sony_Loral_Patent_War

- >cross examは米国政府の御用達と独禁法と桑沢レポートに
- >対する先方からの攻撃が中心でしたがどれも不発に終わりました。

- >特に、Caltechの Dr. Daimon(Hagiwara) が 75年2月20日にソニーに
- >入社している事実がショックを与えたようで、質問が止まってしまいました。

- >Prof. Bowerからも、Dr. Daimon (Hagiwara)が CaltechからSonyに(埋め込み型)
- >CCDの Ion Implantation 構造 (ISSCC1974で学会発表済みでその後中研時代には
- >P+NPNsub接合の Pinned Photo Diode 構造の特許を出願しそのIon Implantation
- >構造解析に活用した) 解析技術を持ち込んだ事実のStoryの流れがすばらしいとの
- >ことでした。

- >佐藤真木さん佐藤七重さん恐れ入りますが、感謝の気持ちを込めて、
- >このe-mailを萩原良昭さんにforwardしてください。

- >萩原さんはこの2晩で100ページ以上にも及ぶ個人資料をfaxで送ってくれました。

- >馬橋さんの証言も成功裏に終わり、今後弁護士と今後の相談を致します。

- >越智
